

お客様各位

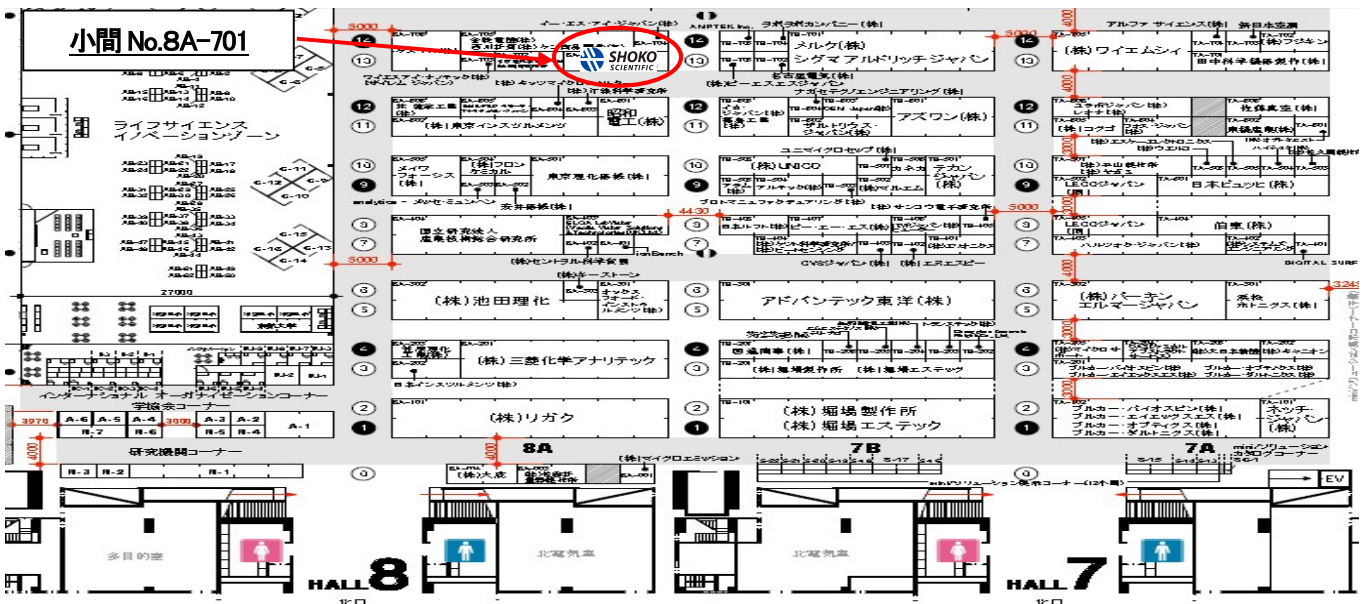
## JASIS2016 出展のご案内

昭光サイエンティフィック株式会社  
理化学機器事業本部

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社は来る2016年9月7日(水)～9月9日(金)の3日間、幕張メッセで開催されます『JASIS2016』に出展致します。ブースでは、高分子分析、ナノ粒子解析、質量分析、分離・分取・精製の各種機器の展示及びご紹介を致します。また、新技術説明会において以下にご案内します4つのテーマで発表致します。ご多忙中とは存じますが、是非ご来場頂き、弊社ブースならびに新技術説明会にお立ち寄り下さいませよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 【ブースご案内図】



### 【新技術説明会】

発表内容：『～ナノ粒子を扱うお客様へ～ ナノ粒子解析の最前線』

日時：9月7日(水) 12:15～13:05

場所：第一会場 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> 2階 A-10

発表内容：『SEC法と何が違う?? 光散乱法による高分子分析の基礎と応用』

日時：9月8日(木) 15:30～16:20

場所：第一会場 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> 2階 A-8

発表内容：『～身近な質量分析へ～ 固、液、気体3態のサンプルをマルチユース質量分析計で分析!』

日時：9月9日(金) 10:30～10:55

場所：第一会場 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> 2階 A-9

発表内容：『遂に実現!! UHPLC用多角度光散乱検出器の紹介』

日時：9月9日(金) 11:50～12:15

場所：第一会場 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> 2階 A-3

## 【出展予定製品】

弊社は、化合物の合成から、分取・精製、分析評価に至るまで、様々な研究支援装置で皆様のご研究にトータルソリューションを提供します。

### <各種サンプルの調整>

〈合成〉

L-COS



最大250℃までの反応槽  
自動化も可能です

\*L-COSはカタログ展示のみとなります

〈分取・精製〉

Purifシリーズ



- ・順相、逆相分取を簡単に
- ・1%グラジエントを実現
- ・ $\mu\text{g}$ ～ $\text{g}$ オーダーの分離・分取を実現
- ・カラムは、SI、NH、DIOL、ODSタイプに加えポリマーゲルタイプ【NEW】を新たに追加

〈化合物分取・分子量探索〉

Purif-CMS



- ・分取中の化合物探索として
- ・高感度検出として

〈高分子・粒子の分離・分取〉

FFF



- ・ $\text{nm}$ ～ $\mu\text{m}$ オーダーの分離、分取システム
- ・カラム担体なしの分離システムのため、様々な溶離液にも対応し、粒子（不溶物）の分離分取も可能

分子量

### <各種サンプルの評価>

#### ■低分子■

##### 四重極型質量分析計

- ・ $m/z$  2000までの質量分析計
- ・各社のLC接続が可能
- ・フロー合成のモニタリングや固型物の迅速測定も対応
- ・スタンドアロンで測定可能



#### ■ナノ粒子■

##### FFF装置

- ・ナノ粒子を液クロのようにサイズ分離
- ・究極の粒子径分布測定を実現
- ・微量分析からセミ分取まで対応



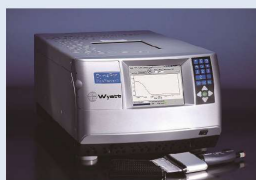
##### 動的光散乱測定器

- ・ナノ粒子の粒子径分布測定
- ・微量分析に対応
- ・高感度分析



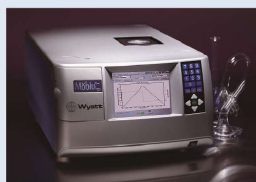
##### プレートリーダー型動的光散乱測定器

- ・市販の96、384、1536プレートに対応
- ・ハイスループットDLS測定の実現



##### ゼータ電位測定器

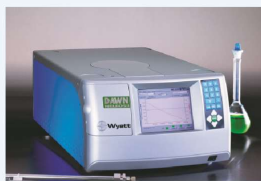
- ・迅速測定の実現
- ・オートサンプラーを使用可能
- ・DLSとゼータ電位の同時測定を実現



#### ■高分子■

##### 多角度光散乱検出器

- ・絶対分子量、分子サイズ分布測定
- ・高分子の構造解析
- ・高分子の分岐度測定



##### 粘度検出器

- ・高分子の固有（極限）粘度測定
- ・HPLCの検出器として迅速測定
- ・高分子の分子形状解析



##### 示差屈折率検出器

- ・光散乱測定に必要な溶媒、溶液の絶対屈折率を測定
- ・高感度、高安定性を誇るRI検出器
- ・ $4^{\circ}\text{C}$ ～ $50^{\circ}\text{C}$ の温調機能を搭載

